

474919-2026 - Concurso

Países Baixos – Equipamento laboratorial, óptico e de precisão (exc. óculos) – European Tender
Electron Beam Lithography system

OJ S 130/2026 09/07/2026

Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal - Anúncio de alteração

Fornecimentos

1. Adquirente

1.1. Adquirente

Nome oficial: Universiteit Twente

Correio eletrónico: c.delfgaauw@utwente.nl

Forma jurídica do adquirente: Empresa pública

Atividade da autoridade adjudicante: Educação

2. Procedimento

2.1. Procedimento

Título: European Tender Electron Beam Lithography system

Descrição: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists, at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e. academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds (photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.

Identificador do procedimento: d75e7f85-f950-4008-ab95-b4ee18bf06fa

Identificador interno: 379fcf7e-45c5-4d48-b8ea-3be831450e85

Tipo de procedimento: Aberto

O procedimento é acelerado: não

2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Fornecimentos

Classificação principal (cpv): 38000000 Equipamento laboratorial, óptico e de precisão (exc. óculos)

Classificação adicional (cpv): 38341100 Registadores de feixes de electrões

2.1.2. Local de execução

País: Países Baixos

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zie documentatie

2.1.3. Valor

Valor estimado, sem IVA: 3 500 000,00 EUR

2.1.4. Informações gerais

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusão

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0000

Título: European Tender Electron Beam Lithography system

Descrição: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists, at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e. academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds (photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.

Identificador interno: 0b4a476d-7047-4e2b-907c-d85c9f9859e4

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Fornecimentos

Classificação principal (cpv): 38000000 Equipamento laboratorial, óptico e de precisão (exc. óculos)

Classificação adicional (cpv): 38341100 Registadores de feixes de electrões

5.1.2. Local de execução

País: Países Baixos

Em qualquer lugar do país em causa

Informações adicionais: Zie documentatie

5.1.3. Duração estimada

Outra duração: Desconhecido

5.1.5. Valor

Valor estimado, sem IVA: 3 500 000,00 EUR

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública total ou parcialmente financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso, Documento europeu único de contratação pública (DEUCP)

5.1.11. Documentos do concurso

Endereço dos documentos do concurso: <https://s2c.mercell.com/today/217278>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Permitido

Endereço para apresentação: <https://s2c.mercell.com/today/217278>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: inglês

Catálogo eletrónico: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 21/08/2026 10:00:00 (UTC+00:00) hora da Europa Ocidental, GMT

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido:
Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Rechtbank Overijssel

Informações sobre os prazos de recurso: See descriptive document.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Universiteit Twente

8. Organizações

8.1. ORG-0001

Nome oficial: Universiteit Twente

Número de registo: 50130536

Endereço postal: Drienerlolaan 5

Cidade: Enschede

Código postal: 7522NB

Subdivisão do país (NUTS): Twente (NL213)

País: Países Baixos

Ponto de contacto: Camilio Delfgaauw

Correio eletrónico: c.delfgaauw@utwente.nl

Telefone: +31534891512

Endereço Internet: <https://www.utwente.nl>

Perfil do adquirente: <https://s2c.mercell.com/buyer/16033>

Funções desta organização:

Adquirente

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso

8.1. ORG-0002

Nome oficial: Rechtbank Overijssel

Número de registo: 82940525

Cidade: Almelo

Código postal: 7607 GB

Subdivisão do país (NUTS): Twente (NL213)

País: Países Baixos

Correio eletrónico: communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl

Telefone: (+31)0883611042

Funções desta organização:

Instância de recurso

10. Alteração

Versão do anúncio anterior a alterar

:

d8072cd8-e497-49af-b432-8865f10c18de-01

Principal motivo da alteração

:

Correção pelo adquirente

Descrição

:

Recently, the University of Twente has started a tender-procedure for the purchase of an electron beam lithography system (T217278 European Tender Electron Beam Lithography system). Unfortunately, we have realized that the Descriptive Document contained several (minor) short-comings. More specific, in the revised Descriptive Document a time-slot for site-inspection is included, as well as a correct textual description of the weighting of the three award criteria is inserted at the end of section 4.2 (viz. 70% (wishes; G1), 10% (sustainability; G2) and 20% (price; G3)). In appendix B Schedule of Requirements and Wishes – the subsection regarding ‘(extended) warranty’ has been removed (table P) and added to the maintenance subsection (see item O.2 in table O).

10.1. Alteração

Identificador da secção: LOT-0000

Os documentos do concurso foram alterados em: 08/07/2026

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: d3fc913d-812e-4d95-a132-8a6de8b80aa4 - 01

Tipo de formulário: Concurso

Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Subtipo de anúncio: 16

Data de envio do anúncio: 08/07/2026 06:24:13 (UTC+00:00) hora da Europa Ocidental, GMT

Data de envio do anúncio eSender: 08/07/2026 06:24:25 (UTC+00:00) hora da Europa Ocidental, GMT

Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: inglês

Número de publicação do anúncio: 474919-2026

N.º de edição do JO S: 130/2026

Data de publicação: 09/07/2026